



Gdańsk, *M. 04. 2013 v.*
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/77/051/D/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „uPzp” Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ”. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

1) Rdz. II pkt. 1

Przed zmianą: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego układu do nanoszenia warstw atomowych (ALD – ang. atomic layer deposition) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Wszystkie elementy wchodzące w przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe - wolne od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będącymi przedmiotem praw osób trzecich. Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich powłok tlenkowych, azotkowych i innych. Stanowisko musi umożliwić rozbudowę układu pozwalającą na zwiększenie potencjału naukowego urządzenia. Realizacja odbywa się w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także przeprowadzenie szkolenia dla minimum 5 pracowników zamawiającego.

Po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego układu do nanoszenia warstw atomowych (ALD – ang. atomic layer deposition) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Za niezbędne oprzyrządowanie i oprogramowanie rozumie się wszelki nie ujęte akcesoria, urządzenia towarzyszą, które konieczne jest do posiadania cech i właściwości, o których mowa w pkt 2 II. Rdz SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy wchodzące w przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe - wolne od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich, oraz posiadały oznakowanie CE. Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich powłok tlenkowych, azotkowych i innych. Poza właściwościami opisanymi w pkt 2 wymaga się aby maksymalna niejednorodność grubości nanoszonych warstw wynosiła 3%, temperatura zewnętrznej części komory nie przekraczała 100 °C podczas pracy urządzenia. Zamawiający oczekuje, aby komora była w pełni metalowa, pozbawiona niemetalowych elementów uszczelniających. Dopuszcza się zastosowanie niemetalowych elementów uszczelniających, pod warunkiem zapewnienia bezpłatnej ich dostawy w celu wymiany zużytych uszczelnień, przez okres 2 lat. Realizacja odbywa się w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także przeprowadzenie szkolenia dla minimum 5 pracowników zamawiającego.

2) Rdz. II pkt 5

Przed zmianą: Wykonawca zapewnia minimum 12 miesięczną gwarancję – szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ - wzorzec umowy.

Po zmianie: Wykonawca zapewnia minimum 12 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu umowy, oraz 24 miesięcznej gwarancji na niemetalowe elementy uszczelniające komorę reakcyjną. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kar umownych, terminów i innych regulacji dotyczących gwarancji zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ - wzorzec umowy.



3) Rdz. IX. Pkt. 12

Przed zmianą: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzytych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika Gdańska
Gmach Główny Skrzydło B
Al. Zwycięstwa 27
80-233 Gdańsk**
i opisane:

**„dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej nr postępowania ZP/77/051/D/13
Nie otwierać przed dniem 15.04.2013 godz. 12:00**

Po zmianie: Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzytych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Politechnika Gdańska
Gmach Główny Skrzydło B
Al. Zwycięstwa 27
80-233 Gdańsk**
i opisane:

**„dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodą ALD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej nr postępowania ZP/77/051/D/13
Nie otwierać przed dniem 06.05.2013 godz. 13:00**

4) Rdz. X. Pkt. 4 oraz 6.

Przed zmianą:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2013 o godz. 11:30.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2013 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach Główny skrzydło B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Po zmianie:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 06.05.2013 o godz. 12:30.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2013 o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach Główny skrzydło B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

5) Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający zamieszcza następujący załącznik.

6) Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – paragraf 4 ust 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„Wykonawca udziela ... (minimum 12) miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu umowy, oraz 24 miesięcznej gwarancji na elementy uszczelniające komorę reakcyjną/ liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (załącznik do SIWZ).”

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

KANCLERZ
mgr inż. Marek Tłok
.....
**(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)**